This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

008280453 **Image available**
WPI Acc No: 90-167454/199022

Resin compsn. for overcoat compsn. of photodiscs - contg. cyclohexyl epoxide derivs., alicyclic epoxide(s) and photocation polymerisation

catalyst

Patent Assignee: NIPPON KAYAKU KK (NIPK)
Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IPC Week

JP 2107630 A 19900419 JP 88260666 A 19881018 199022 B JP 2649711 B2 19970903 JP 88260666 A 19881018 C08G-059/20 199740

Priority Applications (No Type Date): JP 88260666 A 19881018 Patent Details:

Patent Kind Lan Pg Filing Notes Application Patent
JP 2649711 B2 4 Previous Publ. JP 2107630

Abstract (Basic): JP 2107630 A

Resin compsns. contg. (A) cpds. of formula (I), (B) alicyclic epoxides and (C) photocation polymerisation catalysts are new. In (I) R = an organic cpd. residue contg. one active hydrogen in mol.; average value of n = 1-30.

(A) are prepd. by epoxidising vinyl gp. side chain-contg. polycyclohexene oxide obtd. by ring-open-polymerising 4-vinylcyclohexene-1-oxide in the presence of alcohols, phenols, etc.

as initiators, with oxidants e.g. peracid. (C) are pref. polyarylsulphonium complex salts, aromatic sulphonium salts of halogen-contg. complex ions, iodonium salts, etc. The resin compsns. contain 1-60 wt.% (5-40 wt.%) of (A), 39.95-98.95 wt.% (59.9-94.9 wt.%) of (B) and 0.05-0.7 wt.% (0.1-0.5 wt.%) of (C). The resin compsns. may be blended with silicone-alkylene oxide copolymers, acryl polymer, nonbasic fillers e.g. silica, talc, couplers and solvents. The overcoat compsns. comprising the present resin compsns. are useful as protective agent for recording film of photodiscs.

USE/ADVANTAGE - The resin compsns. are useful as overcoat agents for photodisc recording media. The resin compsns. cure under irradiation with ultraviolet rays and have fine adherence to recording media., moisture resistance and excellent hardness. (5pp Dwg.No.0/0)

平2-107630 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

@Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)4月19日

C 08 G 59/20 59/68 7/24 G 11 B

NHP NLE 8416-4 J 8416-4 J

8120-5D

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

図発明の名称

樹脂組成物及び光デイスク用オーパーコート組成物

②特 顛 昭63-260666

В

22出 額 昭63(1988)10月18日

⑫発 明 横 島 者

実

茨城県取手市井野2291

勿出 顋 日本化薬株式会社 人

東京都千代田区富士見1丁目11番2号

79代理 人 弁理士 竹田 和彦

> 書 明

発明の名称

樹脂組成物及び光ディスク用オーバーコート 組成物

- 特許請求の範囲
 - 一般式[[]

$$\begin{array}{c|c}
R & & & H \\
\hline
CH - CH_2 & & & \\
0 & & & & \\
\end{array}$$

(式中、Rは分子中に1個の活性水素を含有す・ る有機化合物の改基を示し、 n の平均値は 1 ~ 30 の数である。)

で表わされる化合物 (A) と脂環式エポキシド(B) と光カチオン重合触媒 (C) を含む樹脂組成物。

2. 第1項記載の一般式[I]で表わされる化合 物 (A) と脂環式エポキシド (B)と光カチオン 重合触媒 (C)を含む光デイスク用オーバーコ 一卜組成物。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、光信号を高速・高密度に記録再生 する光ディスク記録媒体用オーバーコート剂と して有用な紫外線等により硬化し、記録然体に 対する接着性、耐湿性の良好な、硬度の優れた 紫外線硬化型樹脂組成物に関する。

(従来の技術)

現在、民生用のコンパクトディスク記録媒体 用オーバーコート剤として紫外線硬化型オーバ ーコート剤が使用されている。一方、現在、酢 込み、消去の可能な光デイスクの開発が行なわ れており、光デイスク用オーバーコート剤の開 発も進められている。

(発明が解決しようとする課題)

光ディスク用の記録性体は、水分やヒートシ ョックに弱く、オーバーコート剤に対する特性 として、耐水性、耐ヒートショック性、高い硬 度、透明性等の優れた品質が要求されている。

従来使用されているコンパクトディスク用オ

ーパーコート剤は、光ディスクのオーパーコート剤として使用するには、特性が不十分であいて使用できない。 特開昭 5 9 - 7 1 3 1 7 号公報には、ガラスを基材とした光ディスク用の組成化型接着性組成物が提案されている。 この組(となり、フクリレート等の分子中にOH 基を持ており、オーバーコート剤として使用するには耐水性で変更等が不十分であり、不向きである。

(課題を解決するための手段)

上記の問題を解決するため、本発明者らは、 鋭意研究の結果、紫外線により硬化が速く、接 潜性、耐湿性、硬度の優れた光ディスク用材料 を提供することに成功した。すなわち、本発明 は、

ヘキセンオキサイド重合体を過酸等の酸化剤で エポキシ化することによって製造することがで きる。

アルコール類としては、例えばメタノール、 エタノール、プロパノール、プタノール、ペン タノール、ヘキサノール、オクタノール、3一 シクロヘキセンメタノール、ペンジルアルコー ル等がある。フエノール類としては、フエノー・ ル、クレソール等がある。カルポン酸類として は、ギ酸、酢酸、プロピオン酸等がある。チオ ール類としては、メチルメルカプタン、エチル ・メルカプタン、プロピルメルカプタン等があげ られる。また、これら前駆体の有機化合物であ る活性水素を有する化合物はその骨格中に不飽 和2重結合を有していても良く、具体例として はアリルアルコール、アクリル酸、メタクリル 殷、3ーシクロヘキセンメタノール等がある。 これらの化合物の不飽和2重結合は、さらにそ れらがエポキシ化された構造でもさしつかえな 60

(式 [I] 中、 R は、 分子中に 1 個の活性水素 を含有する有機化合物の残基を示し、 n の 平均値は、 1 ~ 3 0 好ましくは 5 ~ 2 0 の 数である。)

と脂環式エポキシド(B)と光カチオン重合触媒(C)を含む樹脂組成物。

2) 1)項記載の一般式(I)で表わされる化合物(A)と脂環式エポキシド(B)と光カチオン重合触媒(C)を含む光ディスク用オーバーコート組成物に関する。

(I) 式で表わされる化合物は、市場より容易に入手することができる。例えば、ダイセル化学工業(例製、 EHPE-3150 (エポキン当債175~195、飲化点72~76℃)等がある。

本発明で使用する脂環式エポキシド(B)の具 体的な例として、3.4ーエポキシシクロヘキシ ルメチルー 3,4 - エポキシシクロヘキサンカル ポキシレート; 3.4ーエポキシー1ーメチルシ クロヘキシルメチルー3,4ーエポキシー1ーメ チルシクロヘキサンカルポキシレート:6-メチルー 3.4 — エポキシシクロヘキ シルメ チルー 6 ーメチルー 3, 4 ーエポキシシクロヘキ サンカルポキシレート; 3,4 - エポキシー 3 -メチルシクロヘキシルメチルー 3,4 ーエポキシ -3-メチルシクロヘキサンカルポキシレート ; 3,4 - エポキシー 5 - メチルシクロヘキシル メチル - 3.4 - エポキシー 5 - メチルシクロへ キサンカルポヤシレート; 2-(3,4-エポキ シシクロヘキシルー 5, 5 ースピロー 3, 4 ーエポ キシ)シクロヘキサンーメタージオキサン;ビ

ス(3,4ーエポキシシクロヘキシルメチル)オ キサレート;ビス(3,4-エポキシシクロヘキ シルメチル)アジペート;ビス(3,4-エポキ シー6ーメチルシクロヘキシルメチル)アジベ ート;ビス(3,4ーエポキシシクロヘキシルメ チル) ピメレート: 4 -- ビニルシクロヘキサン モノエポキシド:ノルボルネンモノエポキシド ;りモネンモノエポキシド等を挙げることがで きる。これら脂環式エポキシド(B)のうち、特 に好ましいものとしては、3.4 - エポキシシク ロヘキシルメチルー3,4ーエポキシシクロヘキ サンカルポキシレート、ビスー(3,4ーエポキ シシクロヘキシルメチル) アジペート、 2 一 (3,4-エポキシシクロヘキシルー5,5-スピ ロー 3,4 ーエポキシ) シクロヘキサンーメター ジオキサン、ビス(2,3-エポキシシクロペン チル)エーテル等が挙げられる。これら脂環式 エポキシド(B)は、1種又は2種以上使用する ことができる。

光カチオン重合触媒 (C) としては、公知のど

する。好適な光カチオン重合触媒は、ポリアリ ールスルホニウム錯塩、ハロゲン含有錯イオン の芳香族スルホニウム塩若しくは、イオドニウ 「ム塩、並びに第Ⅱa、 Va及び VIa 族元素の芳 香族オニウム塩を包含する。これら塩類の幾種 かは、たとえばFC-508若しくはFX-512 (ポリアリールスルホニウムヘキサフルオロホ スフェート及び FD-508(3 Mカンパニー社製)、 あるいは、UVE-1014(ゼネラルエレクトリ ック・カンパニー社製、ポリアリールスルホニ ウムヘキサフルオロアンチモン塩)、SP-170、 SP-150(旭電化㈱製、ポリアリールスルホニ ウムヘキサフルオロホスフエート、ポリアリー ルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート) として販売されているように市販入手すること ができる。これら光カチオン取合触媒 (C) は、 1種または2種以上を任意の割合で混合して使 用する事ができる。

本発明に使用される (A) 成分の 畳は、 樹脂組成物及び光ディスク用オーバーコート 組成物の

のような光カチォン重合触媒でも使用すること ができる。例えば、米国特許 3379653号 公 報に記載されたような1種若しくはそれ以上の 金属フルオロ硼酸塩及び三弗化硼素の錯体、米 国 特 許 3 5 8 6 6 1 6 号 公 報 に 記 載 さ れ た よ う な ビ ス (ペルフルオロアルキルスルホニル) メタン 金属塩、米国特許第3708296号公報に記載さ れたようなアリールジアゾニウム化合物、米国 特許第4058400号記載の第VIa族元素の芳 香族オニウム塩、米国特許第4069055号公報 記載の第 Va 族元素の芳香族オニウム塩、米国特 許第4086091号公報記載の第Ⅱa-Va族元 素のジカルポニルキレート、米国特許第4139 655号公報記載のチオピリリウム塩、米国特許 第 4 1 6 1 4 7 8 号公報記載の M F₆ アニオン(ここ でMは、P、As及びSbより選択される)を有 する第 VIa 族元素、米国特許第 4 2 3 1 9 5 1 号 公報記載のトリアリールスルホニウム錯塩、米 国特許第4256828号公報記載の芳香族イオド ニウム錯塩及び芳香族スルホニウム錯塩を包含

好ましくは 1 ~ 60 重量 8、 特に好ましくは、5 ~ 40 重量 8 が望ましい。 (B) 成分の量は樹脂組成物及び光デイスク用オーバーコート組成物の好ましくは、3 9.9 5 ~ 9 8.9 5 重量 8、 特に好ましくは、5 9.9 ~ 9 4.9 重量 8 である。(C) 成分の量は、樹脂組成物及び光デイスク用オーバーコート組成物の(A) 成分と(B) 成分の総重量に対して、好ましくは、0.0 5 ~ 0.7 重量 8、 特に好ましくは 0.1 ~ 0.5 重量 8 である。

とができる。本発明の組成物の紫外線照射による硬化は常法により行なうことができる。例えば、低圧又は高圧水銀灯、キセノン灯等を用いて紫外線を照射すればよい。本発明の組成物は、特に光ディスク用オーバーコート組成物として有用であるが、その他にも、光ディスク用薄材、金属、ブラスチック、ゴム、紙、木材及びも更、シク用コーティング剤等にも使用できる。

本発明の光ディスク用オーバーコー、ト組成物は特に光ディスクの記録膜の保護剤として、又、コンパクトディスクの記録膜の保護剤として有用である。

本発明の光デイスク用オーバーコート組成物を用いた光デイスクの記録膜の保護膜の形成は、光デイスクの記録膜の上に光デイスク用オーバーコート組成物を例えばスピンコート法等により塗布し、紫外線を照射して硬化することによって保護膜を形成させる。光デイスクの記録膜の上に光ディスク用オーバーコート組成物を塗布する場合、その厚さは通常1~50μ程度とす

外線硬化型光デイスク用オーバーコート組成物を調製した。

ボリカーボネート基板に記録膜を作製(スパックリングにより)した光デイスクの記録膜の上に、上記の紫外線硬化型光デイスク用オーパーコート組成物をスピンコーターで塗布し、高圧水銀灯(東芝社製、2KW)により照射し該組成物を硬化させた。オーパーコートされた光デイスクを60℃の90まRHの状態に放置し、耐湿性試験を行なった処、1000時間経過しても記録膜に異常がなかった。該組成物の硬度は、Shore Dで89であった。

実施例 2.

下記構造式

るのが好ましい。なお、これらの方法において、 光デイスク用オーパーコート 組成物の硬化は、 紫外線照射の代りに電子線照射によることもで きる。

(寒施例)

以下に、本発明を実施例により具体的に説明する。

なお、,実施例中の部は、重量部である。 実施例 1.

下記構造式
R-(H) O H R:-CH₂CH=CH₂
と -CH₂CH-CH₂
O 混合物

を有する化合物(ダイセル化学工業㈱製、EHPE-3150、軟化点 71℃) 30 部、 3,4-エポキンシクロヘキンメチルー 3,4 -エポキンシクロヘキサンカルポキンレート 60 部、 SP-170 (旭電化㈱製、光カチオン重合触媒、プロピレンカーポネート 50 5 希釈品) 0.6 部を混合し紫

を有する化合物(ダイセル化学工業(開製、EHPE-3150 軟化点 71℃)10部、2 — (3,4 — エポキンシクロヘキシルー 5,5 — スピロー 3,4 — エポキン)シクロヘキサンーメタージオキサン 60部、ビスー(3,4 — エポキンシクロヘキシルメチル)アジベート 30部及び SP-170(旭電化(開製、光カチオン重合触媒、プロピレンカーボネート 50 多 希釈品) 0.4 部を混合し、紫外線硬化型光デイスク用オーバーコート組成物を調製した、これを用い、実施例1と同様にして、オーバーコートされた光デイスクを得た。 実施例1と同様に試験を行ない、耐湿性の試験の結果、1000時間経過しても異常がなかった。硬度は、Shore Dで 84 であった。

奥施例3

を有する化合物(ダイセル化学工薬(開製、 EH PE-3150、軟化点、71℃)40部、ビス(2.3 ーエポキシシクロペンチル)エーテル40部、3,4ーエポキシシクロヘキシルメチルー 3,4ーエポキシシクロヘキサンカルポキシレート 20部及びSP-170(旭電化開製、光カチオン重合触媒、プロピレンカーボネート 50名 希釈品)0.3 部を混合し、紫外線硬化型光デイスク 用オーバーコート組成物を調製した。これを用い、実施例1と同様にして、オーバーコートされた光デイスクを得た。実施例1と同様に試験を行ない、耐湿性の試験の結果、1000時間経過しても異常がなかった。硬度は、Shore Dで91であった。

(発明の効果)

本発明の樹脂組成物及び光デイスク用オーバーコート組成物は、硬化して得られる硬化物の 硬度は硬く、耐湿性、接着性に優れ、吸水率が 低く、光デイスク用オーバーコート剤として有 用である。